

第10回電子光技術シンポジウム

電子・光によるプロセッシングとインフォマティクス

半導体製造などのエレクトロニクス製造技術の進展を支えてきたレーザー、プラズマを活用したプロセッシング技術は近年、プロセスインフォマティクスに代表される新たなアプローチの出現により、その様相が変化を見せています。革新的なプロセス開発の現状と将来展望を探ります。

日時 2023年12月18日（月）

定員 **200**名

会場 秋葉原UDXカンファレンス（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX南ウイング6F）
<https://udx-akibaspace.jp/conference>

主催 国立研究開発法人産業技術総合研究所 電子光基礎技術研究部門

共催 一般財団法人 光産業技術振興協会

参加費
無料

プログラム

- 10:00-10:20 開会挨拶 安田 哲二（産業技術総合研究所 執行役員／エレクトロニクス・製造領域 領域長）
小谷 泰久（光産業技術振興協会 副理事長／専務理事）
- 10:20-11:00 【招待講演】 プロセスインフォマティクスを用いた高品質SiC結晶成長技術の開発と展開
宇治原 徹（名古屋大学未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター・教授）
- 11:00-11:20 超伝導関連材料探索におけるインフォマティクスの活用 荻野 拓（電子光基礎技術研究部門）
- 11:20-11:40 レーザー微細加工におけるインフォマティクスの活用 吉富 大（電子光基礎技術研究部門）
- 13:00-13:40 【招待講演】 半導体製造プロセスへの情報技術の適用
守屋 剛（東京エレクトロン株式会社 先端データ企画部）
- 13:40-14:20 【招待講演】 低温プラズマ技術の現状と将来展望
白谷 正治（九州大学大学院 システム情報科学研究院 教授）
- 14:20-14:40 先端半導体材料におけるプロセスダメージの評価と修復 布村 正太（電子光基礎技術研究部門）
- 14:40-15:00 GaN系半導体デバイス開発とプラズマ技術 井手 利英（電子光基礎技術研究部門）
- 15:00-15:20 プラズマ表面処理 一モノからヒトまで 清水 鉄司（電子光基礎技術研究部門）
- 15:40-16:20 【招待講演】 最新レーザ加工技術からAMまで
石出 孝（三菱重工業株式会社 総合研究所フェローアドバイザー）
- 16:20-16:40 金属のレーザー積層造形技術 佐藤 直子（製造技術研究部門）
- 16:40-17:00 液中レーザー溶融法による機能性材料作製技術の開発 石川 善恵（電子光基礎技術研究部門）
- 17:00-17:20 アクティブ制御レーザープロセッシング 奈良崎 愛子（電子光基礎技術研究部門）
- 17:20-17:30 閉会挨拶 澤 彰仁（電子光基礎技術研究部門 研究部門長）

参加申し込み

以下のサイトまたはQRコードからお申込みください。

<https://forms.office.com/r/HDWHFK9Za3>

申込締切 2023年12月8日

※定員になり次第締切らせていただきますので、お早めのお申込をお願いします。

連絡先：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 電子光基礎技術研究部門 シンポジウム担当
M-riaep-symposium2023-ml@aist.go.jp


ともに挑む。つぎを創る。

